

청구범위

- [청구항 1] 비스-에틸헥실옥시페놀 메톡시페닐 트리아진을 포함하는 마이크로입자를 포함하는 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [청구항 2] 제 1항에 있어서,
상기 마이크로입자는,
상기 마이크로입자 총 중량을 기준으로, 비스-에틸헥실옥시페놀 메톡시페닐 트리아진을 20중량% 이상으로 담지하고 있는 것인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [청구항 3] 제 2항에 있어서,
상기 마이크로입자는 반구형인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [청구항 4] 제 1항에 있어서,
상기 마이크로입자의 평균직경은 1 내지 $10\mu\text{m}$ 범위인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [청구항 5] 제 1항에 있어서,
페닐벤즈이미다졸계 화합물 및 사이클로텍스트린계 화합물을 수상에 더 포함하는 것인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [청구항 6] 제 5항에 있어서,
상기 조성물은,
상기 페닐벤즈이미다졸계 화합물 및 상기 사이클로텍스트린계 화합물을 1:0.1 내지 1:10 중량비로 포함하는 것인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [청구항 7] 제 5항에 있어서,
상기 조성물의 pH는 7.5이상인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [청구항 8] 제 5항에 있어서,
상기 조성물은,
하기 관계식1을 만족하는 것인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
[관계식 1]
 $0.1 \leq B/A \leq 1.0$
[상기 관계식1에서,
A는 비스-에틸헥실옥시페놀 메톡시페닐 트리아진의 사용량(g)이고,
B는 페닐벤즈이미다졸계 화합물의 사용량(g)이다]
- [청구항 9] 제 1항에 있어서,
상기 조성물은,
상기 조성물 총 중량을 기준으로, 카르복시기(COO), 케톤기(CO) 및 하이드록시기(OH)에서 선택되는 하나 이상의 극성 작용기를 포함하는 극성오일을 0 내지 1중량%로 포함하는 것인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.

- [청구항 10] 제 1항에 있어서,
상기 조성물은,
PEG 첨가 실리콘계 계면활성제를 더 포함하는 것인 실리콘중수 타입의
화장료 조성물.
- [청구항 11] 제 1항 내지 제10항에서 선택되는 어느 한 항에 있어서,
상기 조성물은 자외선 차단용인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [청구항 12] 제 1항 내지 제10항에서 선택되는 어느 한 항에 있어서,
상기 조성물은,
상기 조성물 총 중량을 기준으로, 상기 비스-에틸헥실옥시페놀
메톡시페닐 트리아진을 0.1 내지 10중량%로 포함하는 것인 실리콘중수
타입의 화장료 조성물.
- [청구항 13] 제 12항에 있어서,
상기 조성물은,
상기 조성물 총 중량을 기준으로, 유기계 자외선 차단제를 25중량%
이하로 함유하며, 하기 식 1에 의해 계산한 상기 조성물의 자외선 차단
지수가 10이상인 실리콘중수 타입의 화장료 조성물.
- [식 1]
자외선 차단 지수 = (실리콘중수 타입의 화장료 조성물을 도포한 피부
부위의 최소 홍반량)/(실리콘중수 타입의 화장료 조성물을 도포하지 않은
피부 부위의 최소 홍반량)